

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成25年8月15日 (2013.8.15)

【公開番号】特開2011-135041 (P2011-135041A)

【公開日】平成23年7月7日 (2011.7.7)

【年通号数】公開・登録公報2011-027

【出願番号】特願2010-217156 (P2010-217156)

【国際特許分類】

H 0 1 F 41/02 (2006.01)

H 0 1 F 7/02 (2006.01)

H 0 1 F 1/057 (2006.01)

H 0 1 F 1/08 (2006.01)

B 2 2 F 1/00 (2006.01)

B 2 2 F 3/02 (2006.01)

B 2 2 F 3/10 (2006.01)

B 2 2 F 3/00 (2006.01)

B 2 2 F 3/20 (2006.01)

C 2 2 C 38/00 (2006.01)

C 2 2 C 19/07 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 F 41/02 G

H 0 1 F 7/02 E

H 0 1 F 1/04 H

H 0 1 F 1/08 B

B 2 2 F 1/00 Y

B 2 2 F 3/02 M

B 2 2 F 3/10 C

B 2 2 F 3/00 F

B 2 2 F 3/20 D

C 2 2 C 38/00 3 0 3 D

C 2 2 C 19/07 E

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月28日 (2013.6.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

希土類化合物を含む磁性粉末と、油及びゴムを含有する油展ゴムと、を含む混合物を成形して成形体を作製する成形工程と、

前記成形体から前記油展ゴムを除去する脱溶媒工程と、

前記油展ゴムを除去した前記成形体を焼成して希土類焼結磁石を得る焼成工程と、を有し、

前記ゴムが、ポリイソブチレン、エチレンプロピレンゴム、スチレンブタジエンゴム、ブタジエンゴム、イソpreneゴム、ブチルゴム及びジエン含有エチレンプロピレンゴムからなる群より選択される少なくとも一種である、希土類焼結磁石の製造方法。

【請求項 2】

前記成形工程において、前記混合物を押出成形して前記成形体を作製する、請求項 1 に記載の希土類焼結磁石の製造方法。

【請求項 3】

前記ゴムは構成元素として酸素を含まない高分子からなる、請求項 1 又は 2 に記載の希土類焼結磁石の製造方法。

【請求項 4】

前記ゴムは炭素間の結合が単結合のみである高分子からなる、請求項 1 ～ 3 のいずれか一項に記載の希土類焼結磁石の製造方法。

【請求項 5】

前記混合物における前記磁性粉末の含有率は 80 ～ 95 質量 % である、請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の希土類焼結磁石の製造方法。

【請求項 6】

前記脱溶媒工程は、前記成形体を加熱して前記成形体から主に前記油を除去する脱油工程と、前記成形体を加熱して前記成形体から主に前記ゴムを除去する脱脂工程とを有している、請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の希土類焼結磁石の製造方法。